

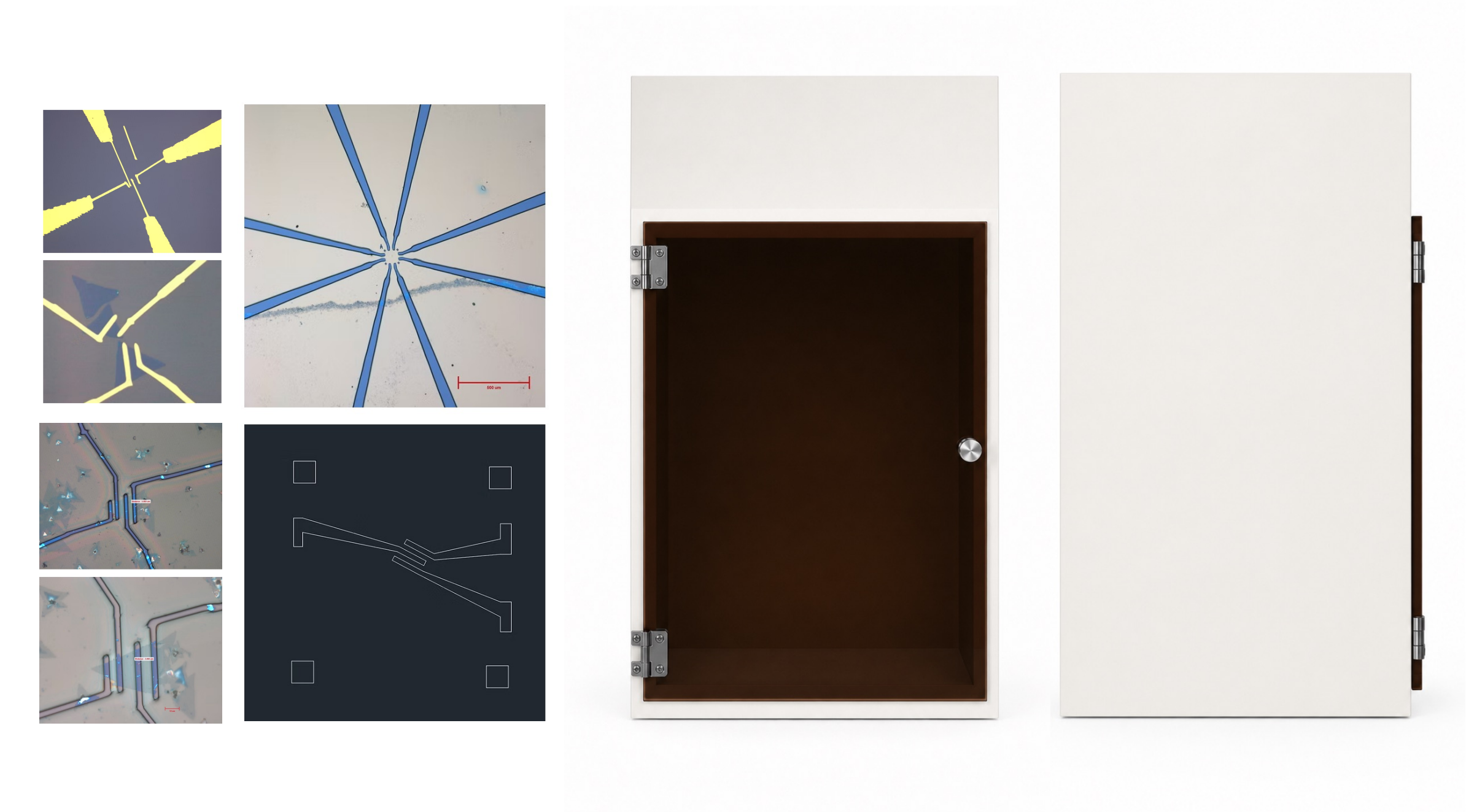
LASER DIRECT WRITER

레이저 다이렉트 라이터

UVW04







레이저 다이렉트 라이터

UVW04

제품 정보	특성	성능	편의 기능
다양한 소자에 대한 포토리소그래피	소규모 연구를 위한 합리적인 가격	최소 선폭: 약 1 μm	CAD (4 layers) 또는 이미지 파일 로드
- 연구용 소자 제작 - 반도체 소자, 태양광 소자 - 미세유체 채널, 랩온어칩	개방형 설계로 수정 가능, 특화된 연구 보장	샘플 스테이지 해상도: 0.125 μm	마우스를 이용해 직접 선 그리기
광학 현미경 + 405nm 레이저 포커스	컴팩트한 디자인 (높이: 47cm), USB 연결 → 글로벌 박스 삽입 가 능	스캔 가능 범위: 최대 25 mm x 25 mm	자동 초점 조정
배율: 5배, 10배, 20배, 50배, 100배			세밀한 패턴과 접촉 패드를 한 번 에 처리
대물렌즈 자동 전환 기능 레이저 포커스, 샘플 포커스 전환 가능		용도	키보드 조작 → 위치 조정
표준 포함 자동 초점 기능		다양한 반도체 소자	마우스 조작 → 샘플의 특정 위치 로 이동
		태양광 에너지 소자 제작	
		미세유체공학, 랩온어칩	

상세정보

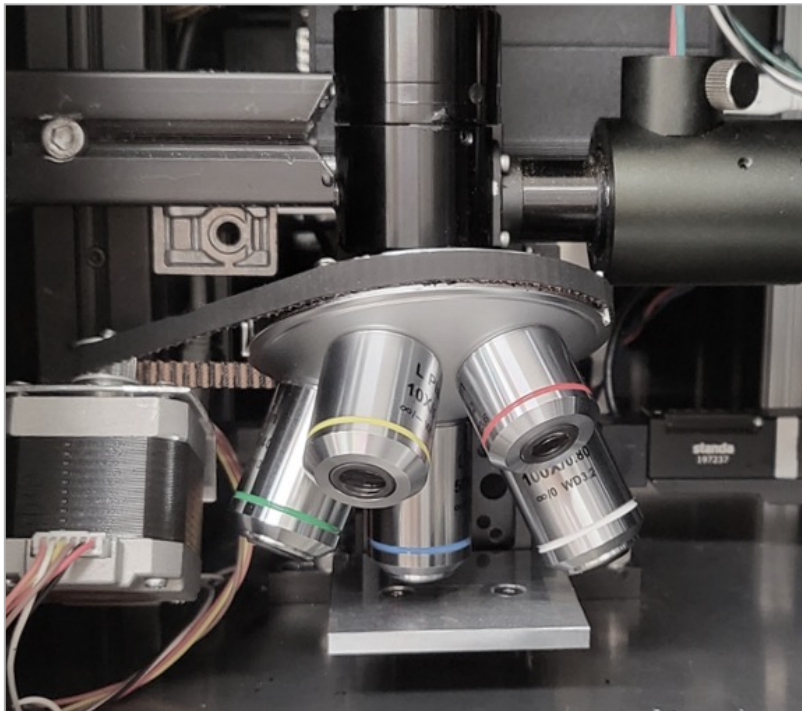
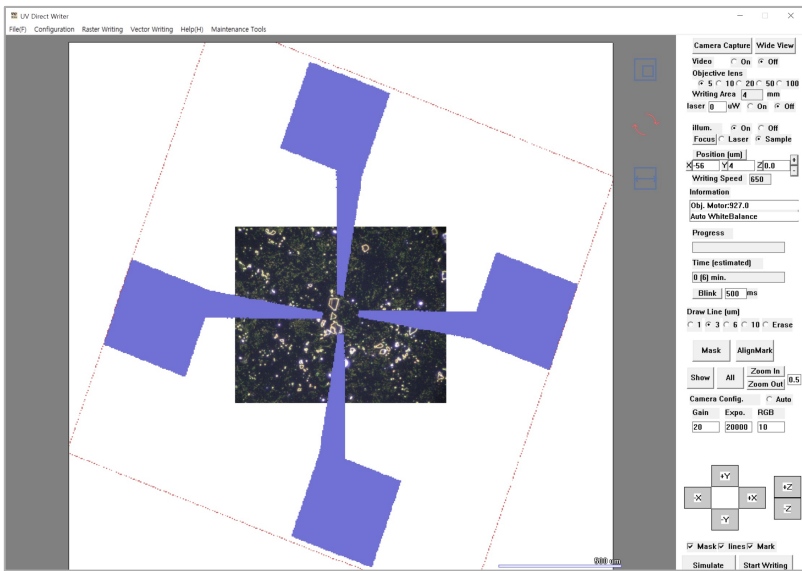
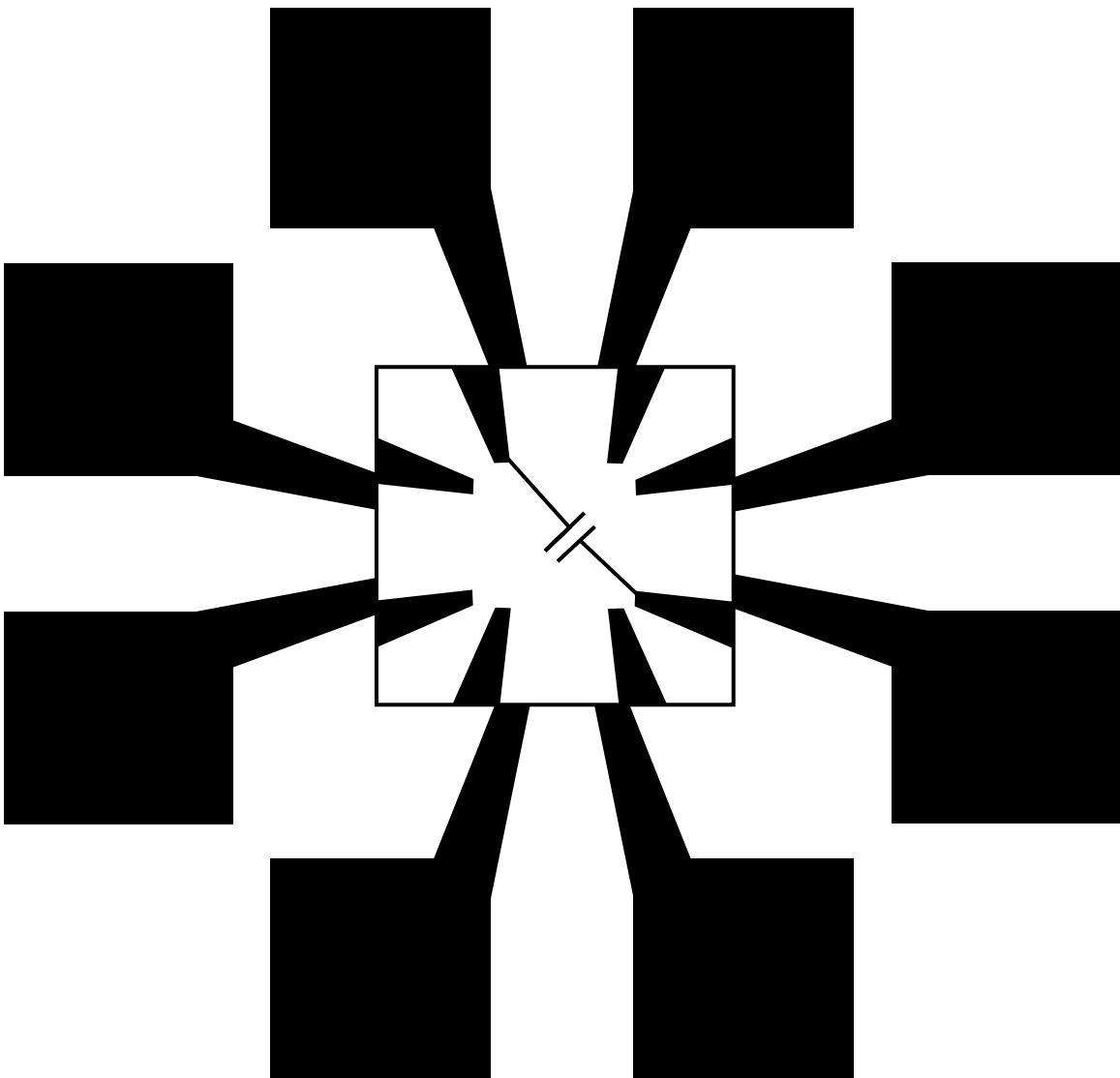
마이크로 포토리소그래피 장비
최소 선폭: <1 μm (PR 두께에 따라 다름)
대물 렌즈: 5배, 10배, 20배, 50배, 100배
대물 렌즈 선택 시 초점 평면 자동 조정
레이저 다이오드: 405 nm, 50 mW
레이저 세기 조정 가능 (100배 대물 렌즈에서 최대 500 μW)
스캔 속도 조정 가능
현미경 이미지를 관찰하며 사용자가 선을 그릴 수 있음
소프트웨어로 확대 및 축소하여 선 그리기 가능

그리기
모드

CAD (.dxf) 패턴 모드
래스터 모드: 흑백 이미지 파일로 영역 채우기
벡터 모드: 마우스 클릭으로 선 패턴 작성

하드웨어

독립형 장비 (PC USB 인터페이스 지원)
샘플 마운트: 5cm x 5cm 평면 스테이지, 대형 웨이퍼 가능
스캐너: 모터 구동 XYZ 스테이지
넓은 시야 영역: 5배 대물 렌즈부터 시작
정밀 정렬: 100배 대물 렌즈 기준
9개 이미지 패치자동 초점 기능
장비 크기 (새시 포함): 28 x 36 x 46 cm³
실시간 쓰기 모니터링 가능한 사용자 인터페이스
마스크 이미지의 마우스 제어: 이동, 확장, 회전 (카메라 이미지 상에서)



“

가성비 최고 의 연구 장치 가공 장비

”

금속 마스크 없이 원하는 패턴을 자유롭게 그릴 수 있음

기존 포토리소그래피 레지스트 그대로 사용 가능

소규모 실험실에서 다양한 장치 전극을 저렴한 가격으로
제작 가능

GPB 및 USB 인터페이스 기능이 표준으로 제공되어 일
반 외부 장치 연결 가능

추가 인터페이스와 소프트웨어 변경에 대한 기술 지원
및 적극적인 지원 제공

컴팩트한 디자인 (높이: 44cm), 단일 USB 연결을 통해 글
로브 박스에 설치 시 가스 분위기 제어 가능

연구 장비의 독립을 목표로.

연구자의 특화된 연구를 위해 자유롭게 개조할 수 있도록 표준화된 부품을 사용합니다.
오픈 소스 기반으로 제작되어 수정 및 특화된 연구를 수행할 수 있습니다.
고객이 원하는 대로 프로그램을 변경할 수 있도록 소프트웨어 라이브러리를 제공합니다.
개별 사용자의 요구를 반영하기 위해 프로그램을 변경합니다(유료 서비스).
1년간 무상 A/S를 보장하며, 10년 동안 PC 변경에 따른 소프트웨어 업데이트를 지원합니다.

